[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 935306

(51) Kv.lk.5 - Int.cl.5

A 61K 49/00, 47/00, 9/51, A 61L 2/26

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **29.11.93**

(24) Alkupäivä - Löpdag **29.11.93**

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **17.06.94**

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

16.12.92 US 991639 P

SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. **Sterling Winthrop Inc.**, 90 Park Avenue, New York, N.Y. 10016, USA, (US)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. **Hollister, Kenneth Robert**, 8 Sycamore Lane, Chester Springs, Pa. 19425, USA, (US)
2. **Ladd, David L.**, 1375 Thomas Road, Wayne, Pa. 19087, USA, (US)
3. **McIntire, Gregory L.**, 113 Piedmont Road, West Chester, Pa. 19382, USA, (US)
4. **Na, George C.**, 1424 Crosby Drive, Ft Washington, Pa. 19034, USA, (US)
5. **Rajagopalan, Natarajan**, 20 Guilford Circle, Phoenixville, Pa. 19460, USA, (US)
6. **Yuan, Barbara O-Ching**, 140 S. Spring Mill Road, Villanova, Pa. 19085, USA, (US)

(74) Asiamies - Ombud: **Oy Kolster Ab**

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Puhdistettujen, pintaa modifioivien aineiden käyttö estämään hiukkasten kasautumista steriloinnin aikana
Användning av renade, ytmodifierande ämnen för att hindra aggregation av partiklar under sterilisation

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee diagnostiseen käyttöön soveltuvia koostumuksia, jotka sisältävät nanohiukkasia, joiden pinnalle on adsorboitu puhdistettua pinta-aktiivista ainetta pintaa modifioivana aineena ja siihen liitetty samepistettä modifioivaa ainetta, jolloin samepistettä modifioivaa ainetta on läsnä riittävä määrä nostamaan pintaa modifioivan aineen samepistettä, ja menetelmää tällaisten nanohiukkasten valmistamiseksi.

Uppfinningen avser en för diagnostisk användning lämplig komposition som omfattar nanopartiklar med en ytmodifikator i form av ett renat, ytaktivt medel på deras ytor och en grumlingspunktmodifikator i förening därmed, varvid grumlingspunktmodifikatorn är närvarande i en mängd som är tillräcklig att öka grumlingspunkten hos ytmodifikatorn, och ett förfarande för framställning av dylika nanopartiklar.